

488696-2026 - Konkurrencevilkår

Irland – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Varer

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Education Procurement Service (EPS)

E-mail: info@educationprocurementservice.ie

Køberens retlige status: Offentligretligt organ

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Beskrivelse: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identifikator for proceduren: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.5. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud: 4

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Beskrivelse: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Intern ID: 1

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 48 Måneder

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: engelsk

Sprog, som udbudsdokumenterne (eller dele heraf) er uofficielt tilgængelige på: engelsk

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: engelsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 180 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Sted: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet

beskæftigelse: Endnu ikke kendte

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: The High Court of Ireland

Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: The High Court of Ireland

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, der behandler tilbud: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Delkontrakt: LOT-0002

Titel: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Beskrivelse: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Intern ID: 2

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 48 Måneder

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: engelsk

Sprog, som udbudsdokumenterne (eller dele heraf) er uofficielt tilgængelige på: engelsk

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: engelsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 180 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Sted: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Endnu ikke kendte

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: The High Court of Ireland

Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: The High Court of Ireland

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, der behandler tilbud: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Delkontrakt: LOT-0003

Titel: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Beskrivelse: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork.

The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Intern ID: 3

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 48 Måneder

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: engelsk

Sprog, som udbudsdokumenterne (eller dele heraf) er uofficielt tilgængelige på: engelsk

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: engelsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 180 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Sted: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet

beskæftigelse: Endnu ikke kendte

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: The High Court of Ireland

Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: The High Court of Ireland

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, der behandler tilbud: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Delkontrakt: LOT-0004

Titel: Plasma Deposition ,PECVD

Beskrivelse: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Intern ID: 4

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): South-East (IE052)

Land: Irland

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 48 Måneder

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: engelsk

Sprog, som udbudsdokumenterne (eller dele heraf) er uofficielt tilgængelige på: engelsk

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00)

centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: engelsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 180 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Sted: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet

beskæftigelse: Endnu ikke kendte

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: The High Court of Ireland

Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: The High Court of Ireland

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Education Procurement Service (EPS)

Organisation, der behandler tilbud: Education Procurement Service (EPS)

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Education Procurement Service (EPS)
Registreringsnummer: IE 6609370 G
Postadresse: Castletroy Limerick
By: Limerick
Postnummer: V94 DK53
Landsdel (NUTS): Mid-West (IE051)
Land: Irland
E-mail: info@educationprocurementservice.ie
Telefon: 000
Internetadresse: <https://www.educationprocurementservice.ie/>
Køberprofil: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Denne organisations roller:

Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud

8.1. ORG-0002

Officielt navn: The High Court of Ireland
Registreringsnummer: The High Court of Ireland
Afdeling: The High Court of Ireland
Postadresse: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
By: Dublin
Postnummer: D07 WDX8
Landsdel (NUTS): Dublin (IE061)
Land: Irland
E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefon: +353 1 8886000

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0003

Officielt navn: European Dynamics S.A.
Registreringsnummer: 002024901000
Afdeling: European Dynamics S.A.
By: Athens
Postnummer: 15125
Landsdel (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)
Land: Grækenland
E-mail: eproc-esender@eurodyn.com
Telefon: +30 2108094500

Denne organisations roller:

TED eSender

10. Ændring

Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Hovedårsagen til ændringen

:

Ajourførte oplysninger

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: engelsk

Bekendtgørelsesnummer: 488696-2026

EUT-S-nummer: 134/2026

Offentliggørelsesdato: 15/07/2026